

令和2年12月4日

会員各位

公益社団法人 応用物理学会  
次世代リソグラフィ技術研究会  
幹事長 井谷 俊郎

## 第1回定例会開催通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、第1回次世代リソグラフィ技術研究会の定例会のご案内が出来ましたので、ご案内させていただきます。新型コロナウイルスの影響でオンライン定例会になります。今回の定例会につきましては、事前登録の必要はございません。アクセス方法については別途ご連絡いたします。

宜しくお願い致します。

敬具

アクセス方法については

3. 参加費： 会員：無料、 非会員：有料（2,000円）\*事務局にお問い合わせ下さい

記

1. 開催日時：令和3年 1月28日（木） 定例会：13:00 – 17:00

2. 開催場所：オンライン定例会（Zoomでのライブ配信）  
アクセス方法については別途連絡。

3. 参加費： 会員：無料、 非会員：有料（2,000円）\*事務局にお問い合わせ下さい

4. プログラム：

13:00～13:05	「開会の挨拶」 大阪大学 井谷 俊郎氏
13:05～13:45	『 半導体フォトカソードを用いた電子ビーム技術の 応用開発と事業化 』 フォトエレクトロニクス/名古屋大学 西谷 智博氏
13:45～14:25	『 IRDS の概要とリソグラフィ技術 』 SDRJ Lithography WG リーダー 石内 秀美氏
14:25～15:05	『 将来のリソグラフィ微細化に向けた大強度 EUV-FEL 光源の 開発状況 』 高エネルギー加速器研究機構 河田 洋氏
15:05～15:20	～ 休憩 ～
15:20～15:45	『 DSA と EUV の組み合わせの可能性について ～インテルの配線プロセスへの応用に関する講演から～ 』 ALITECS 岡崎 信次氏

15:45～16:25	『 コロナ禍におけるナノテクノロジープラットフォーム ～共用施設の感染症予防対策と遠隔技術補助/技術代行～ 』 東京大学 落合 幸徳氏 以上
-------------	---

- 追記：・録画や録音は禁止させていただきます。
- ・発表者以外はミュートをお願いいたします。
  - ・参加者を明らかにするため、ログイン名を所属+名前に変更ください。  
#参加者リストで自分の名前にマウスを合わせ「詳細」をクリックすると  
#名前を変更できます。
- また、ご不明な点がございましたら下記担当者までお問い合わせ下さるようお願い致します。

事務局：公益社団法人 応用物理学会

次世代リソグラフィ技術研究会担当／相良（サガラ） 好美

TEL (携帯)：090-5403-1147

E-mail:ZXF10453@nifty.com